# H<sub>2</sub>分子在 Li<sub>3</sub> N(110) 表面吸附的 第一性原理研究\*

陈玉红<sup>1)2)†</sup> 杜 瑞<sup>1)2)</sup> 张致龙<sup>2)</sup> 王伟超<sup>2)</sup> 张材荣<sup>1)2)</sup> 康 龙<sup>1)</sup> 罗永春<sup>1)</sup>

(兰州理工大学甘肃省有色金属新材料重点实验室,兰州 730050)
 2)(兰州理工大学理学院,兰州 730050)
 (2010年7月16日收到;2010年11月14日收到修改稿)

采用第一性原理方法研究了 H<sub>2</sub> 分子在 Li<sub>3</sub>N(110) 晶面的表面吸附.通过研究 H<sub>2</sub>/Li<sub>3</sub>N(110) 体系的吸附位 置、吸附能和电子结构发现: H<sub>2</sub> 分子吸附在 N 桥位要比吸附在其他位置稳定,此时在 Li<sub>3</sub>N(110) 面形成两个—NH 基,其吸附能为 1.909 eV,属于强化学吸附;H<sub>2</sub> 与 Li<sub>3</sub>N(110) 面的相互作用主要是 H 1s 轨道与 N 2s,2p 轨道的重叠 杂化,N 与 H 之间形成共价键;N 桥位吸附时 H<sub>2</sub> 分子的离解能垒为 1.63 eV,表明在一定热激活条件下 H<sub>2</sub> 分子在 Li<sub>3</sub>N(110) 表面会发生离解吸附;N 顶位吸附时,优化结束后形成—NH<sub>2</sub> 基,但吸附能为负值,即该吸附方式不稳 定,可见 Li<sub>3</sub>N(110) 面与 H,反应不易直接生成 LiNH<sub>2</sub>.

关键词:第一性原理,Li<sub>3</sub>N(110),H<sub>2</sub>,吸附和解离 PACS: 68.43.-h,63.20.dk

# 1. 引 言

能源危机和环境污染是一个全球性的问题.寻求 可再生的能源是目前研究的热点之一. 氢被认为是 一种理想的替代能源,氢能的发展中最关键的技术难 题之一就是氢的储存. 2002 年, Chen 等<sup>[1]</sup>提出 Li<sub>3</sub>N 能够大量可逆吸放氢,其吸放氢反应分两步进行,即  $\text{Li}_3\text{N} + 2\text{H}_2 \longleftrightarrow \text{Li}_2\text{NH} + \text{LiH} + \text{H}_2 \longleftrightarrow \text{LiNH}_2 + 2\text{LiH}.$ 理论上, Li<sub>3</sub>N总储氢量为10.4wt%, 远远超过了 2007年由美国能源部提出的氢燃料电池汽车的应 用目标(6.5wt%). 但Li<sub>x</sub>N具有高键能和高取向性 的化学键,导致其吸放氢反应面临着严重的热力学 和动力学问题.为了改善 Li,N 的吸放氢性能,人们 用 Ca, Mg 等部分替代 Li<sup>[2-5]</sup>,以及通过添加 Ni, Fe, Co, TiCl<sub>3</sub> 等催化剂<sup>[6-8]</sup> 的方法,进行了大量的</sup>实验研究.为了理解 Li,N 的储氢机理,为替代和添 加催化剂研究提供理论依据,人们对 Li<sub>3</sub>N 的电子 结构计算也进行了许多研究, Novák 等<sup>[9]</sup>用局域 自旋密度近似方法对 3d 电子金属替代 Li<sub>3</sub>N 的  $\text{Li}_{2}[(\text{Li}_{1-x}M_{x})N](M = \text{Co}, \text{Ni}, \text{Cu})的电子结构进$  行了研究,认为 *M* 阳离子均为 + 1 价. Samthein 等<sup>[10]</sup>用从头算分子动力学方法研究了 Li<sub>3</sub>N 固体中 的缺陷和扩散行为. 文献[11]用密度泛函理论的 B3LYP/6-31G\*方法对(Li<sub>3</sub>N)<sub>n</sub>(n = 1—5)团簇的结 构与性质进行了探讨,并对最稳定结构的振动特 性、成键特性、电荷特性等进行了理论研究.

Li<sub>3</sub>N的表面状态对氢化反应影响甚大,特别是 吸氢过程的初始时期.目前,关于Li<sub>3</sub>N表面的研究相 对较少,Jin等<sup>[12]</sup>采用基于密度泛函理论的 DMol3 程 序模块,对H<sub>2</sub>分子和H原子在Li<sub>3</sub>N(001)面的吸附 位置、吸附能以及H<sub>2</sub>分子在Li<sub>3</sub>N(001)面的解离能 垒进行了研究,结果表明:H<sub>2</sub>分子在所有的吸附位置 的吸附都不稳定,且未发现H<sub>2</sub>分子解离的吸附位;而 H原子在N顶位吸附时最稳定,但他们对Li<sub>3</sub>N(001) 面的电子结构未作讨论.为此,本文基于第一性原理 方法研究了Li<sub>3</sub>N(110)面的特性以及H<sub>2</sub>分子在Li<sub>3</sub>N (110)面的吸附性质,以期从电子结构层次上寻找H<sub>2</sub> 分子在Li<sub>3</sub>N表面上的吸附位置,研究其吸附构型和 吸附过程,从而揭示H<sub>2</sub>分子与Li<sub>3</sub>N的作用机理,为 进一步的实验研究提供相应的理论指导.

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号:10547007)和兰州理工大学博士基金(批准号:BS10200901)资助的课题.

<sup>†</sup>E-mail: chenyh@lut.cn

<sup>©2011</sup> 中国物理学会 Chinese Physical Society

# 2. 计算方法与模型

### 2.1. 计算方法

本 文 采 用 Material Studio 4.0 软件包中的 CASTEP 计算程序,计算了 Li<sub>3</sub>N(110)/H<sub>2</sub> 的电子结 构,计算中交换关联相互作用采用广义梯度近似 (GGA)下由 Perdew, Burke 和 Ernzerhof<sup>[13]</sup>提出的 PBE 交换关联泛函,并选用超软赝势来描述电子-离 子间的相互作用.选用的平面波截断能为 270 eV, 布里渊区 k 点取样为  $3 \times 3 \times 1$ , 自洽场循环收敛于 2.0 × 10<sup>-6</sup> eV.

k点分别取 6×6×1,5×5×1,4×4×1和 3×3×1进行测试计算,采用 p(2×2)的 4 层 原子来模拟 Li<sub>3</sub>N (110)表面,其相应总能分 别为-13494.4753,-13494.4756,-13494.4752和 -13494.4723 eV,发现 k点取样为 3×3×1和6×6×1时 Li<sub>3</sub>N(110)表面的总能仅相差 0.0032 eV,可 见布里渊区 k点取样为 3×3×1 设定可以保证计算 的精确度.同时采用上述计算参数对单独 H<sub>2</sub>分子 及 Li<sub>3</sub>N 晶体的结构进行了测试计算,所得结果如 下:H<sub>2</sub>分子的 H—H 键长为 0.0752 nm,与实验值 (0.0741 nm)有较好的一致性;Li<sub>3</sub>N 的晶体结构是 六方晶系,优化后的晶格常数为 a = b = 0.3595 nm, c = 0.3847 nm,与实验结果<sup>[14]</sup> (a = b = 0.3641 nm,c=0.3872 nm)符合很好.这表明理论计算精确度较 好,计算模型可靠.

H<sub>2</sub>分子解离能通过 DMol3 软件包计算得到. 自洽场最大允许收敛标准为 1.0×10<sup>-5</sup>,交换关联 相互作用选用 GGA 下的 PW91 泛函<sup>[15]</sup>.

#### 2.2. 计算模型

计算模型采用广泛用于各种表面计算的平板 模型<sup>[16-18]</sup>.考虑到计算精度和计算效率,计算模型 采用  $p(2 \times 2)$  的 4 层 Li<sub>3</sub>N 原子来模拟 Li<sub>3</sub>N(110) 表面. Li<sub>3</sub>N(110)晶面一侧放置一个 H<sub>2</sub> 分子, H<sub>2</sub> 分 子的结构参数取实验值 0.0741 nm. 真空层厚度取 2 nm. 计算模型考虑了 H<sub>2</sub>分子在 Li<sub>3</sub>N(110)面上 可能的 6 种高对称性吸附位——N 顶位、N 桥位 (N-Li-N 中 Li 的顶位)、Li 顶位、Li 短桥位、Li 长桥 位和穴位,分别如图 1 所示. 所有吸附位的 H<sub>2</sub> 分子 都以平行于 Li<sub>3</sub>N(110)面的形式放置.



图 1 H<sub>2</sub>分子在 Li<sub>3</sub>N(110) 面初始位置的俯视图

# 3. 计算结果及讨论

#### 3.1. Li<sub>3</sub>N(110)/H, 吸附构型和吸附能

表1 给出了 H<sub>2</sub> 分子在 Li<sub>3</sub>N(110) 晶面各位置 吸附的几何和能量参数的优化结果,其中  $r_{H-H}$ 为 H 原子之间的距离, $r_{H-Li}$ 为 H 原子与最近的 Li 原子之 间的距离, $r_{H-N}$ 为 H 原子与最近的 N 原子之间的距 离,E为 H<sub>2</sub> 分子解离能, $E_{ads}$ 为吸附能. 吸附能定 义为<sup>[16]</sup>

$$E_{\text{ads}} = E_{\text{clean}} + E_{\text{H}_2} - E_{\text{slab/H}_2}$$

其中 E<sub>slah/H2</sub> 为吸附体系总能, E<sub>clean</sub>为清洁表面总能, E<sub>H2</sub>为 H2 分子总能.根据定义, 吸附能为正, 吸附过程是放热过程, 则吸附是稳定的; 吸附能为负, 吸附过程是吸热过程, 则吸附是不稳定的.

表1 H<sub>2</sub>/Li<sub>3</sub>N(110)体系优化后的几何和能量参数

H <sub>2</sub> 的 初始位置	$r_{\rm H-H}/\rm nm$	$r_{\mathrm{H-Li}}/\mathrm{nm}$	$r_{\rm H-N}/\rm nm$	$E_{\rm ads}/{ m eV}$	$E/\mathrm{eV}$
游离 H <sub>2</sub>	0.0752	_	—	—	4.493
N顶位	0. 1513	0. 1802	0.1056	-0.287	1.470
N 桥位	0. 3389	0. 2173	0.1040	1.689	- 2. 139
Li 顶位	0. 0759	0. 2406	0.3035	0. 195	4. 491
Li 短桥位	0. 0767	0. 2171	0.3688	0. 298	4.488
Li 长桥位	0.0770	0. 2311	0.3241	0.212	4.485
穴位	0. 0766	0. 2488	0.3658	0.250	4.488

从表 1 可知,除了 N 桥位和 N 顶位的其他位置的吸附方式,两个 H 原子之间的距离和 H<sub>2</sub> 分子的解离能较游离 H<sub>2</sub> 分子变化都很小,且吸附能也均小于 40 kJ·mol<sup>-1</sup>(一个 H<sub>2</sub> 分子的吸附能为 0.415

eV),都为物理吸附<sup>[17]</sup>.为了提高计算精度,对N桥 位和N顶位这两种吸附方式,计算模型采用*p*(2× 2)的7层原子来模拟Li<sub>3</sub>N(110)表面重新进行了计 算,所得结果如表2所列.

表 2 H<sub>2</sub>/Li<sub>3</sub>N(110)(7 层 Li<sub>3</sub>N 原子)体系优化后的 几何和能量参数

H <sub>2</sub> 的 初始位置	$r_{\rm H-H}/\rm nm$	$r_{\rm H-Li}/\rm nm$	$r_{\rm H-N}/\rm nm$	$E_{\rm ads}/{ m eV}$	E∕eV
N顶位	0. 1487	0.1777	0. 1048	-0.198	1.576
N 桥位	0.3382	0.2171	0. 1041	1.909	-2.136

从表2可知,N桥位的吸附能明显大于0.415 eV,表明这种吸附为强化学吸附<sup>[17]</sup>.几何优化结构 显示,H原子最终趋于 N 原子的顶位,与 N 原子一 起形成—NH 基(图 2),且 r<sub>H-N</sub>为 0.1041 nm,与 Jin 等<sup>[12]</sup>采用基于密度泛函理论的 DMol3 程序模块得 到的 H 原子在 N 顶位吸附时最稳定的结论以及给 出的键长  $r_{H-N} = 0.105$  nm 相符合, 与 Tsumuraya 等<sup>[19]</sup>采用全势线性级加平面波方法计算得到  $Li_2$ NH的 $r_{H-N}$  = 0.104 nm 的结果基本相同, 与 Li<sub>2</sub>NH 晶体中 r<sub>H-N</sub>的实验值<sup>[20]</sup>(0.0977 nm)也比较 接近. 同时,N桥位吸附方式中两 H 原子之间的距 离为 0.3382 nm, H, 分子的解离能已成负值 (-2.136 eV),可见 H<sub>2</sub>分子已经完全解离. 对于 N 顶位吸附方式,几何优化结束后形成---NH,基(图 3),但吸附能为负值(此吸附为吸热反应),因此这 种吸附方式不稳定,可见 Li<sub>3</sub>N (110) 面和 H<sub>2</sub> 反应 不易直接生成 LiNH<sub>2</sub>. 而文献[12]认为,H<sub>2</sub>分子在 Li<sub>3</sub>N(001)面的所有吸附均为物理吸附.



图 2 H<sub>2</sub> 分子在 Li<sub>3</sub>N (110) 面 N 桥位优化后的结构



图 3 H<sub>2</sub> 分子在 Li<sub>3</sub>N (110) 面 N 顶位优化后的结构

# 3.2. Li<sub>3</sub>N(110)/H<sub>2</sub> 吸附体系的 Mulliken 电荷布 居分析

H<sub>2</sub>分子在 Li<sub>3</sub>N 表面吸附,必然伴随着原子间 的电荷转移和表面电子结构的变化.因此,根据 H<sub>2</sub> 分子吸附前后 Li<sub>3</sub>N 表面的 Mulliken 电荷布居,可以 得出 H<sub>2</sub>分子与 Li<sub>3</sub>N 表面相互作用的信息.计算表 明,H<sub>2</sub>分子在 N 桥位吸附时最稳定,因此进一步研 究了 H<sub>2</sub>分子在 N 桥位吸附前后的电荷布居数.

表 3 H, 分子在 N 桥位吸附前后的电荷布居数

原子层         原子         吸附前         吸附后           H         0.13         H         0.13           H         0.13         H         0.13           N         -1.03         -1.12           第一层         Li         0.56         0.56           Li         0.23         0.24           N         -0.99         -0.99           第二层         Li         0.42         0.43           Li         0.30         0.30           N         -0.99         -0.98           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.52         0.51           Li         0.52         0.51           Li         0.52         0.51           Li         0.52         0.51           Li         0.51         0.50           Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01		2		
H         0.13           H         0.13           N         -1.03         -1.12           第一层         Li         0.56         0.56           Li         0.23         0.24           N         -0.99         -0.99           第二层         Li         0.42         0.43           Li         0.42         0.43           Li         0.30         0.30           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.52         0.47           Li         0.52         0.47           Li         0.52         0.51           M         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.51         0.50         1.1           Li         0.21         0.22         N      <	原子层	原子	吸附前	吸附后
H         0.13           N         -1.03         -1.12           第一层         Li         0.56         0.56           Li         0.23         0.24           N         -0.99         -0.99           第二层         Li         0.42         0.43           Li         0.30         0.30           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.52         0.51         0.26           N         -0.98         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.51         0.50         -1.01		Н		0.13
N         -1.03         -1.12           第一层         Li         0.56         0.56           Li         0.23         0.24           N         -0.99         -0.99           第二层         Li         0.42         0.43           Li         0.30         0.30           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.51         0.50         1.1           Li         0.21         0.22         N		Н		0.13
第一层         Li         0.56         0.56           Li         0.23         0.24           N         -0.99         -0.99           第二层         Li         0.42         0.43           Li         0.30         0.30           N         -0.99         -0.98           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01		Ν	-1.03	-1.12
Li         0.23         0.24           N         -0.99         -0.99           第二层         Li         0.42         0.43           Li         0.30         0.30           N         -0.99         -0.98           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01	第一层	Li	0. 56	0.56
N         -0.99         -0.99           第二层         Li         0.42         0.43           Li         0.30         0.30           N         -0.99         -0.98           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01		Li	0. 23	0.24
第二层         Li         0.42         0.43           Li         0.30         0.30           N         -0.99         -0.98           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01		Ν	- 0. 99	- 0. 99
Li         0.30         0.30           N         -0.99         -0.98           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.52         0.51         0.51           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01	第二层	Li	0.42	0.43
N         -0.99         -0.98           第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01		Li	0.30	0.30
第三层         Li         0.52         0.47           Li         0.20         0.23           N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01		Ν	- 0. 99	- 0. 98
Li         0.20         0.23           N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01	第三层	Li	0. 52	0.47
N         -0.98         -0.98           第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01		Li	0.20	0. 23
第四层         Li         0.52         0.51           Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01		Ν	- 0. 98	- 0. 98
Li         0.27         0.26           N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01	第四层	Li	0. 52	0.51
N         -0.98         -0.98           第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01		Li	0. 27	0.26
第五层         Li         0.51         0.50           Li         0.21         0.22           N         -1.02         -1.01		Ν	- 0. 98	- 0. 98
Li 0. 21 0. 22 N -1. 02 -1. 01	第五层	Li	0.51	0.50
N -1.02 -1.01		Li	0.21	0. 22
		Ν	-1.02	- 1. 01
第六层 Li 0.42 0.41	第六层	Li	0.42	0.41
Li 0. 25 0. 26		Li	0. 25	0.26
N -0.96 -0.96		Ν	- 0. 96	- 0. 96
第七层 Li 0.55 0.55	第七层	Li	0. 55	0.55
Li 0. 25 0. 26		Li	0. 25	0.26

表3列出了H<sub>2</sub>分子在N桥位吸附前后的电荷 布居数.从表3可知,第一层N原子的电荷变化较 大,Li原子的电荷变化较小;第二层至第七层原子 的电荷基本没有变化.这表明H<sub>2</sub>分子主要与第一 层N原子相互作用,同时也说明采用7层Li<sub>3</sub>N原子 层晶体来模拟H<sub>2</sub>/Li<sub>3</sub>N(110)体系是可以满足计算 要求的.H<sub>2</sub>分子在Li<sub>3</sub>N(110)面吸附后,Li<sub>3</sub>N (110)面得到电子带负电(-0.26),即表面电势降 低、功函数减小,从而使Li<sub>3</sub>N更活泼,也更易于发生 化学反应.

#### 3.3. Li<sub>3</sub>N(110)/H<sub>2</sub>吸附体系的态密度分析

 $H_2$ 分子在 N 桥位吸附时最稳定,因此讨论了其 在 N 桥位吸附前后的态密度.图4 给出了  $H_2$  分子 在 N 桥位解离吸附后,  $Li_3N(110)/H_2$  吸附体系的 态密度,图中以费米能级  $E_F$  作为能量零点.为了对 比说明,图5 给出了纯  $Li_3N(110)$  晶面和游离  $H_2$  分 子的态密度.由此可以看出:吸附前  $Li_3N(110)$  晶 面的价带在 -2.5-0 eV 能量区间,主要是 Li 2s, 2p 和 N 2p 轨道的贡献;导带在 1.0-3.0 eV 能量区



图 4 Li<sub>3</sub>N (110)/H<sub>2</sub> 体系的态密度



图 5 纯 Li<sub>3</sub>N(110) 晶面和游离 H<sub>2</sub> 分子的态密度

间,主要是 Li 2s,2p 轨道的贡献. 吸附后的价带在 -4.0—-1.0 eV 能量区间,主要是 Li 2s,2p 和 N 2p 轨道的贡献;导带在 0—2.5 eV 能量区间,主要 是 Li 2s 和 Li 2p 轨道的贡献. 吸附后价带和导带都 向深能级处移动,可见 H<sub>2</sub> 分子与 Li<sub>3</sub>N(110)面存在 相互作用;H 1s 轨道和 N 2p 轨道有显著的分裂展 宽,说明 H<sub>2</sub> 分子与 Li<sub>3</sub>N(110)面的作用主要源于表 层 N 原子与 H 原子之间的作用. 吸附后的 H 原子 的态密度已经高度离散化,这说明 H<sub>2</sub> 分子已经分 解. H 1s 轨道与 N 2s,2p 轨道重叠,且共振明显,显 示出强共价性. 电荷密度分析(图 6)也显示出这一特征,由此可知,N与H之间形成共价键.

#### 3.4. 解离过渡态和解离能垒

 $H_2$  分子与 Li<sub>3</sub>N 发生反应的前提是  $H_2$  分子解 离为两个 H 原子. 计算表明,  $H_2$  分子在 N 桥位吸附 时最稳定且 H—H 键被解离,因此研究了其解离过 程. 利用线性协同变换(linear synchronous transit) 与二次协同变换(quadratic synhronous transit)相结 合的方法研究了  $H_2$  分子在 Li<sub>3</sub>N(110)面解离过程



图 6 H<sub>2</sub> 分子在 N 桥位吸附后的电荷密度分布

的过渡态<sup>[21]</sup>. 终态结构为 H<sub>2</sub> 分子在 Li<sub>3</sub>N(110)面 N 桥位解离后的结构, 初态结构为 H<sub>2</sub> 分子置于 Li<sub>3</sub>N(110)面 N 桥位的初始结构. 搜索得到的过渡 态如图 7 所示, 过渡态中 H—N 键长分别为 0. 1816



图 7 Li<sub>3</sub>N(110)面上 H<sub>2</sub>分子解离过程中的过渡态

- [1] Chen P, Xiong Z T, Luo J Z, Lin J Y, Tan K L 2002 Nature 420 302
- [2] Hino S, Ichikawa T, Leng H Y, Fujii H 2005 J. Alloys Compd. 398 62
- [3] Chen Y, Wu C Z, Wang P, Cheng H M 2006 Int. J. Hydrogen Ener. 31 1236
- [4] Liu Y F, Hu J J, Xiong Z T, Wu G T, Chen P, Murata K J, Sakata K 2007 J. Alloys Compd. 432 298
- [5] Okamoto K, Tokoyoda K, Ichikawa T, Fujii H 2007 J. Alloys Compd. 432 289
- [6] Ichikawa T, Isobe S, Hanada N, Fujii H 2004 J. Alloys Compd.
   365 271
- [7] Isobe S, Ichikawa T, Hanada N, Leng H Y, Fichtner M, Fuhr O, Fujii H 2005 J. Alloys Compd. 404—406 439
- [8] Yao J H, Shang C, Aguey-Zinsou K F, Guo Z X 2007 J. Alloys Compd. 432 277
- [9] Novák P, Wagner F R 2004 J. Magn. Magn. Mater. 272 e269

和 0. 1763 nm,两个 H 原子之间的距离为 0. 1744 nm,H—H 键的解离能为 0. 5912 eV,说明 H—H 键被削弱.通过 Mulliken 电荷布居分析可知,此时  $H_2$ 分子的总电荷为 -0.22,说明在过渡态结构中有较 多的电子从 Li<sub>3</sub>N 表面转移到  $H_2$  分子中,使得H—H 键得到活化,易于断裂分解为两个 H 原子.由初态 和过渡态的能差计算得到的解离能垒为 1. 63 eV, 说明  $H_2$  分子的解离需要一定的热激活条件.

# 4. 结 论

采用第一性原理方法研究了 H<sub>2</sub> 分子在 Li<sub>3</sub>N (110)晶面的表面吸附.结果表明:吸附的最稳定结构是 H<sub>2</sub> 分子初始位置在 N 桥位,几何优化结果显示,最终 H 原子分别趋于两个 N 原子的顶位,形成两个—NH 基,此时吸附能为 1.909 eV,属于强化学吸附.H<sub>2</sub> 分子与 Li<sub>3</sub>N 表面的相互作用主要源于 H 1s 轨道与 Li<sub>3</sub>N 表层 N 原子的 2s,2p 轨道重叠杂化的贡献,且 N—H 键为共价键,其键长为 0.1041 nm. H<sub>2</sub> 分子解离能为 – 2.136 eV,H<sub>2</sub> 分子被完全分解, 其解离能垒为 1.63 eV,表明在一定热激活条件下 H<sub>2</sub> 分子在 Li<sub>3</sub>N(110)表面会发生离解吸附.对于 N 顶位吸附方式,几何优化结束后形成—NH<sub>2</sub> 基,但 吸附能为负值,因此这种吸附方式不稳定,可见 Li<sub>3</sub>N(110)面和 H,反应不易直接生成 LiNH,.

- [10] Sarnthein J, Schwarz K, Blöchl P E 1996 Phys. Rev. B 53 9084
- [11] Chen Y H, Kang L, Zhang C R, Luo Y C, Pu Z S 2008 Acta Phys. Sin. 57 4174 (in Chinese) [陈玉红、康 龙、张材荣、 罗永春、蒲忠胜 2008 物理学报 57 4174]
- [12] Jin H M, Luo J Z, Wu P 2007 Appl. Phys. Lett. 90 084101
- [13] Perdew J P, Burke K, Ernzerhof M 1996 Phys. Rev. Lett. 77 3865
- [14] Schulz H, Schwarz K 1978 Acta Crystallograp. A 34 999
- [15] Perdew J P, Chevary J A, Vosko S H, Jackson K A, Pederson M R, Singh D J, Fiolhais C 1992 Phys. Rev. B 46 6671
- [16] Luo W H, Meng D Q, Li G, Chen H C 2008 Acta Phys. Sin. 57
   160 (in Chinese)[罗文华、蒙大桥、李 赣、陈虎翅 2008 物 理学报 57 160]
- [17] Meng D Q, Luo W H, Li G, Chen H C 2009 Acta Phys. Sin. 58
   8224 (in Chinese) [蒙大桥、罗文华、李 赣、陈虎翅 2009
   物理学报 58 8224]
- [18] Zhao W, Wang J D, Liu F B, Chen D R 2009 Acta Phys. Sin.

**58** 3352 (in Chinese) [赵 巍、汪家道、刘峰斌、陈大融 2009 物理学报 **58** 3352]

- [19] Tsumuraya T, Shishidout T, Oguchi T 2007 J. Alloys Compd. 446-447 323
- [20] Balogh M P, Jones C Y, Herbst J F, Hector L G Jr, Kundrat M

2006 J. Alloys Compd. 420 326

 [21] Liu Y X, Zheng D S, Zhang Y, Jiang L, Li G X, Guo J 2008 Chin. J. Nonferr. Metal. 18 1692 (in Chinese) [刘奕新、郑 定山、张 怡、蒋 龙、黎光旭、郭 进 2008 中国有色金属
 学报 18 1692 ]

# First principles study of $H_2$ molecule adsorption on $Li_3 N(110)$ surfaces<sup>\*</sup>

Chen Yu-Hong<sup>1)2)†</sup> Du Rui<sup>1)2)</sup> Zhang Zhi-Long<sup>2)</sup> Wang Wei-Chao<sup>2)</sup>

Zhang Cai-Rong<sup>1)2)</sup> Kang Long<sup>1)</sup> Luo Yong-Chun<sup>1)</sup>

1) (Key Laboratory of Advanced Non-ferrous Metal Materials of Gansu Province, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China)

2) (School of Science, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China)

(Received 16 July 2010; revised manuscript received 14 November 2010)

#### Abstract

The adsorption of  $H_2$  on a Li<sub>3</sub>N(110) crystal surface is studied by first principles. Preferred adsorption sites, adsorption energy, dissociation energy and electronic structure of the  $H_2/\text{Li}_3N(110)$  systems are calculated separately. It is found that  $H_2$  is adsorbed on the N bridge site more favorably than on the other sites, while two —NH radicles are formed on the Li<sub>3</sub>N(110) crystal surface. The calculated adsorption energy on the N bridge site is 1.909 eV, belonging to a strong chemical adsorption. The interaction between  $H_2$  and Li<sub>3</sub>N(110) surface is due mainly to the overlapping among H 1s, N 2s and N 2p states, through which covalent bonds are formed between N and H atoms. An activation barrier of 1.63 eV is found for the dissociation of  $H_2$  molecule in N bridge configuration, which indicates that the dissociative adsorption of  $H_2$  on Li<sub>3</sub>N(110) surface is favorable under the certain heat activation condition; —NH<sub>2</sub> radicle is formed after the optimization of  $H_2$  adsorbed on the N top site. The adsorption energy on the N top site is negative. In other words, this adsorption is unstable. So it is concluded that it is not easy to produce the LiNH<sub>2</sub> between Li<sub>3</sub>N(110) face and  $H_2$  directly.

Keywords: first principles,  $Li_3N(110)$ ,  $H_2$ , adsorption and dissociation **PACS**: 68.43.-h, 63.20. dk

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10547007) and the Foundation for the Doctor of Lanzhou University of Technology, China (Grant No. BS10200901).

<sup>†</sup> E-mail: chenyh@ lut. cn